

Chemyforest® Murumuru

「修護皮膚屏障 提升保濕 賦予柔軟絲滑的觸感」



天然植物來源

源自亞馬遜地區的木魯木魯 (Murumuru) 星狀果種籽，採用特殊溫和的工藝精煉，並透過冷壓、低溫與高真空製程，完整保留原料的天然特性與成分。

Chemyforest® Murumuru 富含月桂酸與肉豆蔻酸，能迅速融入皮脂膜，修復受損的皮膚屏障，並形成保護膜。也能應用於「受損髮絲修護」。



COSMETICS



COSMOS APPROVED



源自巴西 亞馬遜地區



臨床功效

➤ 強效保濕

使用 Chemyforest® Murumuru 3%濃度的配方能顯著降低經表皮水分流失率。



顯著減少經皮水分流失，達到深層滋養與極佳的保濕潤膚效果。

TEWL - 經表皮水分流失

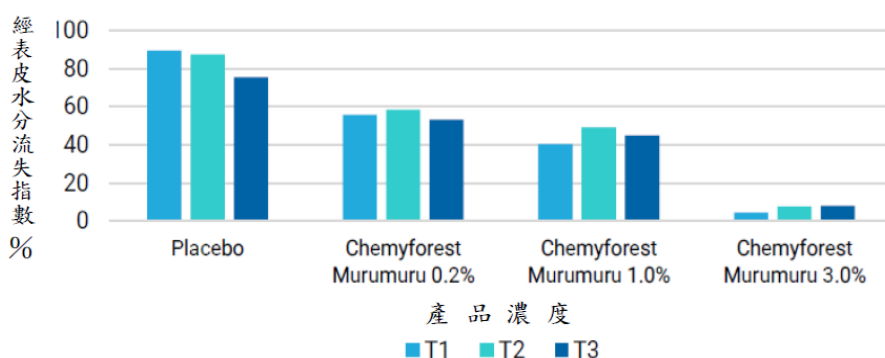


圖 1：TEWL - 經表皮水分流失

➤ 修護肌膚屏障

使用 Chemyforest® Murumuru 3%濃度的配方，單次塗抹後，皮膚屏障的修護效果可高達 94.8%



皮膚屏障的改善

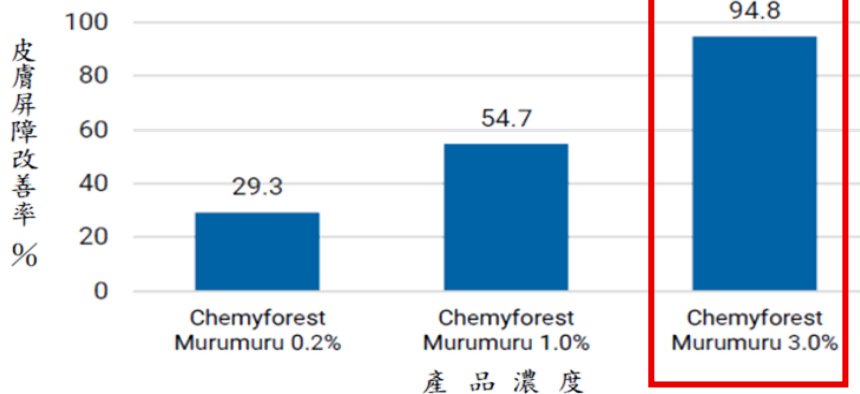


圖 2：皮膚屏障的改善。

適用推薦：  高度潤膚、強效保濕，深層滋養、絲滑觸感，適合乾性肌膚、受損髮質護理產品。

詳細資料及操作方式，歡迎來電



慶驊國際有限公司

241新北市三重區三和路四段390巷20號1樓

電話: 02-2280-7791 傳真: 02-2280-7792

E-mail: service@chenhwah.com <http://www.chenhwah.com>